

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年11月19日(2009.11.19)

【公表番号】特表2007-504311(P2007-504311A)

【公表日】平成19年3月1日(2007.3.1)

【年通号数】公開・登録公報2007-008

【出願番号】特願2006-525102(P2006-525102)

【国際特許分類】

C 08 F 293/00 (2006.01)

【F I】

C 08 F 293/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成21年9月30日(2009.9.30)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項7】

モノマーBはノナエチレングリコールメチルエーテルアクリレート又はノナエチレングリコールメチルエーテルメタクリレートである請求項1～3及び5いずれか1項記載のコポリマー。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0018

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0018】

好ましくは、nは2以上であり、R²はメチル基又はエチル基である。nの値は25まで、又はそれ以上でも良い。例えばnは約2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、18、20、22、又は25である。

好ましくはpは2であり、nは2以上であり、R²はメチル基又はエチル基である。ジエチレングリコールエチルエーテルアクリレート(DEGA)又はジエチレングリコールエチルエーテルメタクリレートは使用できるモノマーBの例である。メトキシエチルアクリレートは特に好ましくない。ノナエチレングリコールメチルエーテルアクリレート(nEGA)又はノナエチレングリコールメチルエーテルメタクリレートは他のモノマーBの例である。

モノマーBは分岐しているヒドロキシ基を有するモノマー、例えばヒドロキシエチル(メタ)アクリレート及びポリエトキシル化(polythoxylated)化合物に対して利点をもたらす：即ち、モノマーBは非常に低い副反応架橋をもたらす。

【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0079

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0079】

実施例4：ジブロックコポリマーp(nEGA)₃₀₀₀₀-b-p(TMAMS)₁₁₀₀₀(ポリノナエチレングリコールメチルエーテルアクリレートブロックポリ{[2-(ア

クリロキシ)エチル]トリメチルアンモニウムメチルサルフェート)の合成

ステージ1：モノブロックp(*n*EGA)₃₀₀₀₀の合成

成分：エタノール30.0g。水130.0g。ノナエチレングリコールメチルエーテルアクリレート165.0g。商標「ザンテートA」1.145g。S₂O₈(NH₄)₂0.250g。

手順：上記成分は機械攪拌器を備えた500ml重合容器中に導入される。ゴム製セプタムキャップで封じた後、内容物は乾燥窒素で60分間バブルされ、次に70℃迄加熱され、この温度で8時間維持される。少量のサンプルが取り出され転換を確認される。固体含有量は50%である。